BEST AVAILABLE COPY

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-210167

(43)Date of publication of application: 31.08.1988

(51)Int.CI.

C09B 57/00 G03G 5/06

(21)Application number : 62-042897

27.02.1987

(71)Applicant: FUJI XEROX CO LTD

(72)Inventor: AKASAKI YUTAKA

TOKIDA AKIHIKO TORIGOE KAORU TANAKA HIROYUKI

SUDO HIDEMI

(54) METHOD OF PURIFYING SQUARYLIUM PIGMENT

(57)Abstract:

(22)Date of filing:

PURPOSE: To obtain a high-purity squarylium pigment suitable for use in producing electrophotographic materials having improved characteristics, by dissolving a squarylium pigment in 2-chloroethanol to recrystallize or reprecipitate it. CONSTITUTION: A squarylium pigment of formula I is purified by dissolving it in 2-chloroethanol and then recrystallizing or reprecipitating it. In the formula I, R1, R2, R3 and R4 are each a 1W20C alkyl, a substd. or unsubstituted phenyl or benzyl of formula II (wherein R7 is H, a 1W6C alkyl, OH, a 1W4C alkoxy, or the like), R5 and R6 are each H, OH, methyl, halogen or the like. The squarylium pigments of formula III (wherein R10, R11, R12 and R13 are each methyl, ethyl or the like) are particularly preferred. A typical example of the pigment of formula I is 2,4-bis[4'(p-chlorobenzylmethylamino)phenyl]-1,3- cyclobutadiene-diylium-1,3-diolate.

$$\frac{R_1}{R_2} > N - \bigcirc \qquad \bigcirc \qquad \bigcirc \qquad \frac{R_2}{O} - \bigcirc \qquad \bigcap \\ R_4 = N - \bigcirc \qquad \bigcirc \qquad \qquad N = N$$

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

THIS PAGE BLANK (USPTO)

四公開特許公報(A)

昭63-210167

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号 Z-7537-4H ❸公開 昭和63年(1988)8月31日

C 09 B 57/00 5/06 G 03 G

103

7381-2H

未請求 発明の数 1 (全9頁) 審查請求

スクエアリリウム顔料の精製方法

願 昭62-42897 20特

昭62(1987)2月27日 29出

72発 明 者 赤 神奈川県南足柄市竹松1600番地 富士ゼロツクス株式会社

豊

明 者 田 勿発

彦 明

薫

竹松事業所内 神奈川県南足柄市竹松1600番地 富士ゼロツクス株式会社

析松事業所内

越 79発 明 老

神奈川県南足柄市竹松1600番地 富士ゼロツクス株式会社

東京都港区赤坂3丁目3番5号

析松事業所内

富士ゼロツクス株式会 願人 വ്ധ

社

剛 弁理士 渡 部 個代 理 人

最終頁に続く

明細書

1. 発明の名称

・スクエアリリウム顔料の精製方法

2. 特許請求の範囲

(1)下記一般式(I)で示されるスクエアリリ ウム顔料を2-クロロエタノールに溶解し、再結 晶又は再沈澱させることを特徴とするスクエアリ リウム顔料の精製方法。

[式中、 R_1 、 R_2 、 R_3 及び R_4 は、それぞれ **炭素数1~20のアルキル基、置換あるいは未置** 換のフェニル基、又は

(式中、R7は水素原子、炭素数1~6のアルキ ル基、水酸基、炭素数1~4のアルコキシ基、ハ ロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、カルボキシル 基、炭素数1~4のアルコキシカルボニル基又は トリフルォロメチル基を表わす)で示されるペン ジル基を表わし、R5及びR6は、それぞれ水寮 原子、水酸基、メチル基、ハロゲン原子、トリフ ルオロメチル基、カルボキシル基、

-NHCOR₈ 又は-NHSO₂ R₉ (式中、 R 8 及びR 9 は、それぞれ置換基を有してもよい アルキル基又はフェニル基)を表わす。] (2)スクエアリリウム顔料が下記一般式(Ⅱ) で示されることを特徴とする特許請求の範囲第1

項に記載の精製方法。

[式中、R₁₀、R₁₁、R₁₂及びR₁₃はそれぞれメ チル基、エチル基又は

- . 2

(式中、R 16は水素原子、メチル基、水酸基、メトキシ基、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ニトロ基、シアノ基、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基又はトリフルオロメチル基を表わす)で示されるペンジル基を表わし、R 14及びR 15は、それぞれ水素原子、水酸基、メチル基又はフッ素原子を表わす。〕

3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は電子写真特性を改善するためのスクエ アリリウム顔料の精製方法に関する。

従来の技術

従来、電子写真感光体として、無定形セレン、 セレン合金、硫化カドミウム、酸化亜鉛等の無機 系感光材料やポリピニルカルバゾール及びポリピ ニルカルバゾール誘導体に代表される有機系感光 材料が広く知られている。

- 3 -

したがって、本発明の目的は、高感度で、しかも帯電性が高く、暗滅衰が小さく、残留電位が低く、繰返し使用に対する安定性に優れた電子写真感光体を製造するのに適した、高純度なスクエアリリウム顔料を提供することにある。

問題点を解決するための手段

本発明の上記目的は、スクエアリリウム顔料を 2 - クロロエタノールに溶解し、再結晶もしくは 近年、多種類の有情となって、 有発生層とは、 をををでして、 のの感ををでして、 をでは、 をでは、 をでは、 ののでででででででででである。 がのでででである。 がのででである。 がのででは、 ののででである。 がのででである。 がのででは、 ののででは、 ののでは、 ののででは、 ののでは、 ののでのである。 ののである。 をは、 ののである。 ののである。 をは、 ののである。 のでである。

一方、有機額料の一般的精製法としては、有機 溶媒による再結晶法、硫酸によるアシッドペース ティング法、アミンによる再沈法、昇華精製法等 が知られている。

発明が解決しようとする問題点

ところで、スクエアリリウム顔料を電子写真感

- 4 -

再沈設させて精製することによって達成される。 本発明に用いるスクエアリリウム顔料は、以下 一般式(I)で示される。

$$\frac{R_{1}}{R_{2}} > N \xrightarrow{R_{5}} 0 \xrightarrow{R_{6}} N < \frac{R_{3}}{R_{4}}$$
 (I)

[式中、 R_1 、 R_2 、 R_3 及び R_4 は、それぞれ 炭素数 $1\sim 20$ のアルキル基、置換あるいは未置 換のフェニル基、又は

(式中、R7は水素原子、炭素数1~6のアルキル基、水酸基、炭素数1~4のアルコキシ基、ハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、カルボキシル基、炭素数1~4のアルコキシカルボニル基を表りフルオロメチル基を表わす)で示されるペンジル基を表わし、R5及びR6は、それぞれ水素原子、水酸基、メチル基、ハロゲン原子、トリフルオロメチル基、カルボキシル基、

- 6 -

 $-NHCOR_8$ 又は $-NHSO_2$ R_9 (式中、 R_8 及び R_9 は、それぞれ置換基を有してもよい アルキル基又はフェニル基)を表わす。]

特に、下記一般式(Ⅱ)で示されるスクエアリ リウム顔料が好ましく用いられる。

[式中、 R_{10} 、 R_{11} 、 R_{12} 及び R_{13} はそれぞれメチル基、エチル基又は

(式中、R₁₆は水素原子、メチル基、水酸基、メトキシ基、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ニトロ基、シアノ基、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基又はトリフルオロメチル基を表わす)で示されるベンジル基を表わし、R₁₄及びR₁₅は、それぞれ水素原子、水酸基、メチル基又はフッ素原子を表わす。〕

- 7 -

$$0 = \bigvee_{C \mid I} C \mid I \xrightarrow{R_5} \bigvee_{R_2} N \stackrel{R_1}{\underset{R_2}{\longrightarrow}}$$

$$0 - \bigvee_{C, I}^{R_5} N \stackrel{R_5}{\underset{R_2}{\longleftarrow}} N \xrightarrow{m \wedge \beta \#}$$

$$0 - \bigvee_{OH}^{R_5} N <_{R_2}^{R_1} - \bigvee_{OH}^{R_6} N <_{R_4}^{R_3}$$

$$\frac{R_1}{R_2} > N - \frac{R_5}{Q_2} - \frac{Q_2}{Q_2} - \frac{R_6}{R_4}$$

一般式(I)で示されるスクエアリリウム顔料のうち、四員環をはさんだ左右が対称のスクエアリリウム顔料は、スクエアリン酸と対応するアニリン誘導体より公知の方法により容易に合成することができる。又、四員環をはさんだ左右が非対称のスクエアリリウム顔料は、下記反応式に示す反応により合成することができる。

- 8 -

一般式(I)で示されるスクエアリリウム顔料の代表的なものとして、次のものが例示される。 (1) 2 , 4 - ピス - [4 ´(p - クロロベンジルメチルアミノ)フェニル]-1 , 3 - シクロブタジエン - ジィリウム - 1 , 3 - ジオレート

 $(3) 2, 4-UZ-(4^{-1}-IFNXFNPS)$ $JJ_{II}=JJ_{II}=JJ_{II}$ $JJ_{II}=JJ_{II}$ $JJ_{II}=JJ_{II}$ $JJ_{II}=$

 $(4) 2, 4-UX-(4^{-}-9)$ + WY=1/2+ UY=1/2+ UY=1/2+

(5) 2, 4 - ピス- (2´- フルオロ- 4´-ジメチルアミノフェニル) - 1, 3 - シクロプタ ジエン-ジイリウム- 1, 3 - ジオレート

(6) 2. 4ーピスー(4 ージベンジルアミノフェニル) -1.3ーシクロブタジェンージイリ

- 10 -

ウムー1,3ージオレート

(9) $2-(4^{-}-ジメチルアミノフェニル)-4-(2^{-}-メチルー4^{-}-ジメチルアミノフェニル)-1,3-シクロプタジエンージイリウム-1,3-ジオレート$

 $(10) 2 - (4^{-} - \Im X + \pi \nabla Z) - \pi \nabla Z - (4^{-} - \Im X + \pi \nabla Z) - \pi \nabla Z - \pi \nabla$

(11) 2 - (2´-フルオロ-4´-ジメチルア ミノフェニル) - - 4 - [4´-(p-クロロベ ンジルメチルアミノ) フェニル] - 1,3 - シク - 11 -

ジルメチルアミノ) - 2 ´ - フルオロフェニル] - 1 . 3 - シクロプタジエン - ジイリウム - 1 . 3 - ジオレート

(19)2-(2 $^{\circ}$ - $^{$

 $(20) 2 - (2^{-} - 7 N \pi G - 4^{-} - 7 N \pi G - 4^{-} - 7 N \pi G - 4^{-} - 7 N \pi G - 7$

(21)2-(2 $^{\circ}$ -ヒドロキシー4 $^{\circ}$ -ジメチルア ミノフェニル)-4-(2 $^{\circ}$ -メチルー4 $^{\circ}$ -ジ メチルアミノフェニル)-1-3-シクロプタジ ロプタジエンージイリウムー 1. 3 ージオレート (12) 2. 4 ーピスー(2´ーヒドロキシー4´ー ジメチルアミノフェニル)ー1. 3 ーシクロプタ ジェンージイリウムー1. 3 ージオレート

(13) 2 , 4 - ビス - (2 ´ - メチル - 4 ´ - ジメ チルアミノフェニル) - 1 , 3 - シクロプタジエ ン - ジイリウム - 1 , 3 - ジオレート

(14)2,4-ビス-(3´-フルオロ-4´-ジ メチルアミノフェニル)-1,3-シクロブタジ エン-ジイリウム-1,3-ジオレート

エンージィリウムー1,3-ジオレート

 $(23) 2 - (4^{-} - \Im X + N + N + 2) - (2^{-} - 2 + N + 2) - (2^{-$

(26)2-(2´.6´-ジフルオロ-4´-ジメ - 14 - $(27)2-(2^{\circ},6^{\circ}-3)7u\pi u-4^{\circ}-3x$ $furs_{0}=2u^{\circ}-4-[4^{\circ}-4]$ $ur_{0}=4u^{\circ}-4$ $ur_{0}=4u^{\circ}-$

本発明においては、上記一般式(I)で示されるスクエアリリウム顔料を2ークロロエタノールを用いて再結晶もしくは再沈澱させる。

再結晶は、スクエアリリウム顔料を2ークロロエタノール中に溶解させて行うが、その際の加熱温度は60℃から130℃(還流温度)が好ましく、100℃から130℃が特に好ましい。2ークロロエタノールは単独で用いても、又、他のの媒、例えば、水、エタノール等のアルコール系溶媒、トルエン等の芳香族系溶媒、トリクロロエタン等のハロゲン化炭化水素系溶媒等と混合して用ー 15 ー

ーテルで洗浄後、乾燥して、下記構造式の2.4 ーピスー[4 (pークロロベンジルメチルアミノ)フェニル]ー1.3ーシクロブタジエンージィリウムー1.3ージオレート(例示化合物(1)) 18.2g(収率38%)を得た。

$$CH_{3} \rightarrow V - O - O - V < CH_{3} \rightarrow CH_{2} - O - CH_{3}$$

いてもよい。又、塩酸等の酸を添加してもよい。

再沈殿は、スクエアリリウム顔料を2ークロロエタノールに溶解し、貧溶媒と混合することによって行うが、その際の加熱温度は、再結晶の場合と同様である。貧溶媒としては、水、エタケール系溶媒、トルエン等の芳色化水系溶媒、トルエン等の方で化炭化水系溶媒等が用いられる。又、再沈澱の際の貧溶媒の比率は、2ークロロエタノールに対し1/2倍容量の範囲が好ましい。

実施例

以下、本発明を実施例によって詳細に説明する。 実施例1

3、4ージヒドロキシー3ーシクロプテンー1、2ージオン 10.0gとNー(ロークロロベンジル)-N-メチルアニリン 61.0gをプタノール 400㎡とトルエン 200㎡の混合溶媒中に入れ、還流し、生成する水を除去しながら8時間反応した。放冷後、生成した青緑色の結晶を濾別し、プタノール、メタノール、ジエチルエー 16 ー

応用例1

実施例1によって精製された例示化合物(1) 1重量部にポリピニルブチラール樹脂(積水化学 製、BXL (登録商標))1重量部、シクロヘキサ ノン 40重量部を加え、ボールミルで4時間粉 砕、混合した分散液を、パーコーターを用いてア ルミニウムを蒸着したポリエステルフィルム(東 レ製、メタルミー(登録商標))上に塗布し、乾 燥して厚さり、2μπの電荷発生層を形成した。

次に、得られた電子写真感光体について、静電 複写紙試験装置(川口電気製、エレクトロスタティック・ペーパーアナライザー、SP428) を用い

- 18 -

て、一6 k V のコロナ放電を施して負帯電させた 後、2 秒間暗所に放置し、続いて、タングステン ランプを用い、表面の照度が5 ルックスになるよ うに感光層に光照射を施した。

帯電直後の電位をVo、2秒間暗所放置後の電位をVDDP、表面電位がVDDPの1/2になる露光量をE1/2、5ルックスの光を1〇秒照射した後の表面電位をVRPとし、同様の測定を2〇回線返し行った。

その結果を第1表に示す。

第	1	表
---	---	---

		• • •		
	V 0	V DDP	E 1/2	V RP
	(V)	(V)	(ルックス・秒)	(V)
1回目	780	750	3.0	5
20回目	775	745	3.0	5

参考例 1

実施例1における未精製の例示化合物(1)を 用い、応用例1と同様にして電子写真感光体を作 成し、同様に評価した。その結果を第2表に示す。

- 19 -

第 3 表

	V 0	V DDP	E 1/2	V RP
	(V)	(V)	(ルックス・秒)	(V)
1回目	775	745	3.0	5
20回目	770	730	3.0	5

実施例3

。 3. 4 - ジクロロー3 - シクロプテンー1,2 - ジオン 25 g 及び三フッ化ホウ素エチルエーテル錯体 6. 5 wを塩化メチレン 30 m に溶解し、N - ジメチルーのフルオロアニリンを混合し、空温で16時間間機拌して次ので洗浄し、カラムクロマトグラフィーを用して、次がで洗浄し、カラムクロロー4 - (2 ´ ー ジメチルアミノフェニル)ー3 - シカロー4 ´ ージメチルアミノフェニル)ー3 ーシクロプテンー1,2 ージオン 9. 1 g (収率72%)を得た。

次いで、この3.-クロロー4-(2´-フルオロ-4´-ジメチルアミノフェニル)-3-シク

第 2 表

	V 0	VDDP	E 1/2	V RP
	(V)	(V)	(ルックス・秒)	(V)
10目	750	690	5.2	10
20回目	700	630	5.0	10

実施例2

実施例1のおける未精製の例示化合物(1) 4.0gを2ークロロエタノール 400㎡に入れ、還流温度で20分間加熱し、熱時濾過後、直ちに遮液にメタノール 200㎡を注ぎ入れ、放冷した。析出した結晶を濾別し、精製された例示化合物(1)3.6g(収率90%)を得た。 応用例2

実施例2によって精製された例示化合物(1)を用い、応用例1と同様にして電子写真感光体を作成し、同様に評価した。その結果を第3表に示す。

- 20 -

ロプテンー1, 2ージオン 7. 6gに酢酸 120 m 及び水 40 m を加え、2時間還流し、放冷後、析出した結晶を遮別、水洗いして3ーヒドロキシー4ー(2´ーフルオロー4´ージメチルアミノフェニル)ー3ーシクロプテンー1, 2ージオン 6.7g(収率95%)を得た。

次いで、この3ーヒドロキシー4ー(2 ´ーフルオロー4 ´ージメチルアミノフェニル) 2 ーシメチルアミノフェニル 4 ・ 0 gをを変え 1 ・ 2 ージメチルイジン 6・ 9 gをを返したり 3 4 0 配中に入れ、1 6 時間を返したり 1 を見したり 1 を見したり 2 ー フルオロー 4 ・ 2 ー フルカール 2 ー フェニル 1 ー 3 ー ジェーン 2 ー フェニル 2 ー 1 ・ 3 ー ジェーン 4 ・ 1 g(収率 6 8 %)を得た。

次いで、例示化合物(2) 2.6gを2ークロロエタノール 260㎡に入れ、還流温度で10分間加熱し、熱時濾過後、遮液を放冷し、析出した結晶を濾別し、精製された化合物(2)2.1g(収率81%)を得た。

応用例3

実施例3によって精製された例示化合物(2)を用い、応用例1と同様にして電子写真感光体を作成し、同様に評価した。その結果を第4表に示す。

簱 **V** RP E 1/2 V DDP V 0 |(ルックス・秒)|(V) (V) (V) 1.0 690 720 1回目 0 1.0 685 715 20回目

- 23 -

実施例4によって精製された例示化合物(3)を用い、応用例1と同様にして電子写真感光体を作成し、同様に評価した。その結果を第6表に示す。

第 6 表

		212		
	V 0	V DDP	E 1/2	V RP
	(V)	(V)	(ルックス・秒)	(V)
1回目	850	830	20.0	20
20回目	850	825	20.0	20

参考例3

実施例4における未精製の例示化合物(3)を 用い、応用例1と同様にして電子写真感光体を作 成し、同様に評価した。その結果を第7表に示す。

第 7 表

		N,		
	V 0	V DDP	E 1/2	V RP
<u> </u>	(V)	(V)	(ルックス・秒)	(V)
1回目	720	650	18.0	25
20回目	680	600	17.0	25

参考例 2

実施例3における未精製の例示化合物(2)を 用い、実施例2と同様にして電子写真感光体を作 成し、同様に評価した。その結果を第5表に示す。

第 5 表

		71.	· ~	
	V 0	VODP	E 1/2	V RP
	(V)	(V)	(ルックス・秒)	(V)
1回目	600	540	1.0	10
20回目	530	470	0.9	10

実施例4

未精製の2、4ービスー(4 ーエチルメチルアミノフェニル)ー1、3ーシクロプタジエンージイリウムー1、3ージオレート(例示化合物(3)) 3.0gを2ークロロエタノール25歳とエタノール25歳の混合溶媒中に入れ、遠流温度で10分間加熱し、熱時濾過後、濾液を放冷し、析出した結晶を遮別し、精製された化合物(3) 2.7g(収率80%)を得た。応用例4

- 24 -

実施例5~12及び参考例4~11

例示化合物(4)~(11)について、2-クロロエタノールを用い、実施例1におけると同様に再結晶処理を行い、それぞれ精製された化合物を得た。

精製された例示化合物(4)~(11)について、応用例1と同様にして電子写真感光体を作成し、同様に評価した。その結果を第8表に示す。 又、再結晶処理を行わない例示化合物(4)~ (11)を用い、応用例1と同様にして電子写真 感光体を作成し、同様に評価した。その結果を第 9表に示す。

第 8 表

	化合物		V0	V DDP	E1/2	VRP
実施例	Na		(V)	(V)	(ルックス・秒)	(V)
_	(4)	198	845	820	1.3	5
5	(4)	20回目	840	810	1.3	5
_	(5)	198	700	660	0.8	0
6	(5)	20回目	685	645	0.8	0
		108	910	890	13.0	10
7	(6)	20回日	890	865	13.0	10
· _	(7)	108	830	770	0.9	0
8	(7)	20回目	810	745	0.9	0
	(0)	108	760	725	1.1	0
9	(8)	20回目	760	725	1.1	0
40	(0)	108	820	800	1.5	0
10	(9)	20回目	800	780	1.5	0
11 (10)	108	815	800	4.2	5	
	(10)	20回日	810	795	4.2	5
	(44)	108	880	860	1.0	0
12	(11)	20回日	880	860	1.0	0

练9表

	化合物		VO	VDDP	E1/2	V RP
参考例	No.		(V)	(V)	(ルックス・秒)	(V)
		108	710	670	1.2	10
4	(4)	20回目	670	625	1,1	10
		108	600	500	0.9	0
5	(5)	20回日	550	460	0.9	0
		108	780	750	11.0	20
6	(6)	20回目	750	710	10.0	20
		108	350	240	1.2	10
7	(7)	20団目	275	180	0.9	10
	1	100	420	320	1.0	10
8	(8)	20回目	380	260	1,1	10
	(0)	108	740	700	1.6	5
9	(9)	20回日	700	660	1.8	5
	1	1回目	690	650	3.9	20
10	(10)	20回日	670	630	3.9	20
	1445	108	820	780	1.1	0
11	(11)	20回目	800	760	1.1	1 0

- 27 -

発明の効果

本発明は、上記の構成を有するから、従来の構成を有するから、従来の構成を有するから、従来容易に特別であったスクエアリリウム類料は、って処理されたスクエアリリウム類料は、電子写の成光体における電荷発生材料として使用の高感度で、しかも帯電性が高に暗滅衰が小さく、残留電位が低く、繰返し使用に対する安定性に優れた電子写真感光体を形成することができる。

特許出願人 富士ゼロックス株式会社 代理人 弁理士 変部 剛 - 28 -

第1頁の続き @発 明 者 田 中 浩 之 神奈川県南足柄市竹松1600番地 富士ゼロックス株式会社 竹松事業所内 @発 明 者 須 藤 秀 美 神奈川県南足柄市竹松1600番地 富士ゼロックス株式会社 竹松事業所内

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
 □ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
 □ FADED TEXT OR DRAWING
 □ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
 □ SKEWED/SLANTED IMAGES
 □ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
 □ GRAY SCALE DOCUMENTS
 □ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
 □ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.